

gangen (Meßmethodik; Batterien, Sensoren, Gaspumpen, photoelektrochemische Zellen etc.). Auswahl und knappe Darstellung liefern vor allem dem Neuling auf dem Gebiet unverbrämmt und unüberladen die nötige Information.

Dem aber nicht nur oberflächlich Interessierten bieten sich in vieler Hinsicht auch Grund zu Kritik. Es ist dies zum einen die sehr große Zahl von Druckfehlern (die hoffentlich in einer nächsten Ausgabe behoben werden), nicht nur die weniger störenden, weil offensichtlichen, sondern auch und vor allem solche, die dem Leser mit Sicherheit Kopfzerbrechen bereiten. Ich erspare mir Beispiele. Zum andern ist es die fehlende Präzision bei der Behandlung der Themen, die ich an einigen Fällen verdeutlichen möchte:

1. Die Defektnotation wird nicht streng durchgehalten. Ohne Grund wird von Bau- und Strukturelementbeschreibung gewechselt und beides vermischt (siehe z. B. 18/S. 131). Ebenso werden für die ionischen Defekte Relativsymbole für die Ladung benutzt, für die elektronischen Defekte hingegen Absolutsymbole.

2. Im Kapitel „Electronic Conduction in Metals and Semiconductors“ wird es versäumt, die gerade für dieses Buch bedeutsamen Sprachbarrieren zwischen Chemikern und Physikern zu brechen. Zusammenhänge werden ansatzweise und nur für Spezialfälle gegeben. So findet sich auf S. 14: „ $\Delta G^\circ/N_e$  [die 2 fehlt] =  $\mu_e = E_g/2 = E_F$ “.

3. Bei der Diskussion der Konzentrationszellenmethode (S. 158) wird das elektrochemische Potential mit dem elektrischen verwechselt, was zwar (durch doppelten Fehler) zu einer schnelleren Ableitung führt, aber für einen Physikochemiker unverzeihlich ist. Auf S. 159 und S. 190 findet sich die

gleiche heuristische Diskussion derselben Methode ohne Querverweise.

4. Darüber hinaus ist das Buch nicht in allen Fragen auf dem neuesten Stand (z. B. Grenzflächenleitfähigkeit, S. 92). Die theoretisch-mechanistische Seite, auf der in der letzten Zeit viele Fortschritte erreicht wurden, bleibt größtenteils ausgespart. Dies mag didaktisch begründbar sein, nur wird dadurch der zu Beginn erhobene Anspruch nicht erfüllt.

Der Rezensent will mit seiner Kritik nicht vom Kauf abschrecken – dies leistet eher der Preis von DM 174 –, sondern lediglich zur Vorsicht beim Konsum mahnen.

Joachim Maier [NB 1149]

Max-Planck-Institut  
für Metallforschung, Stuttgart

## Berichtigung

In der Zuschrift „Bis( $\eta^6$ -phosphabenzol)vanadium: Synthese, Redoxeigenschaften, Struktur und konformative Beweglichkeit“ von C. Elschenbroich et al. (*Angew. Chem. 103* (1991) 601) lautet die vollständige Autorenliste C. Elschenbroich, M. Nowotny, B. Metz, W. Massa, J. Graulich, Karl Biehler und Wolfgang Sauer.

In Tabelle 2 betragen die EPR-spektroskopischen Werte von 7 für  $A_z(^5\text{V})$  nicht 23.0, sondern 2.30;  $A_{x,y}(^1\text{H})$  nicht 3.75, sondern 0.375;  $A_z(^1\text{H})$  nicht 3.0, sondern 0.30.

---

Angewandte Chemie, Fortsetzung der Zeitschrift „Die Chemie“

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dgl. in dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu der Annahme, daß solche Namen ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich häufig um gesetzlich geschützte eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.

© VCH Verlagsgesellschaft mbH, W-6940 Weinheim, 1991

Printed in the Federal Republic of Germany

Telefon (06201) 602-0, Telex 465516 vchwh d, Telefax (06201) 602328, E-Mail Z16@DHDURZ2 in Earn Bitnet

Geschäftsführer: Hans Dirk Köhler, Dr. Hardy G. Sehrt

Verantwortlich für den wissenschaftlichen Inhalt: Dr. Peter Göltz

Anzeigeneleitung: Rainer J. Roth



Die Auflage und die Verbreitung wird von der IVW kontrolliert.

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikrofilm oder irgendeinem anderen Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. All rights reserved (including those of translation into foreign languages). No part of this issue may be reproduced in any form – by photoprint, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without the permission in writing of the publishers. – Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen dürfen nur einzelne Vervielfältigungsstücke für den persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt werden. Die Weitergabe von Vervielfältigungen, gleichgültig zu welchem Zweck sie hergestellt werden, ist eine Urheberrechtsverletzung.

Der Inhalt dieses Heftes wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung. – This journal was carefully produced in all its parts. Nevertheless, authors, editor and publisher do not warrant the information contained therein to be free of errors. Readers are advised to keep in mind that statements, data, illustrations, procedural details or other items may inadvertently be inaccurate.

**Valid for users in the USA:** The appearance of the code at the bottom of the first page of an article in this journal (serial) indicates the copyright owner's consent that copies of the article may be made for personal or internal use, or for the personal or internal use of specific clients. This consent is given on the condition, however, that the copier pay the stated percopy fee through the Copyright Clearance Center, Inc., for copying beyond that permitted by Sections 107 or 108 of the U.S. Copyright Law. This consent does not extend to other kinds of copying, such as a copying for general distribution, for advertising or promotional purposes, for creating new collective works, or for resale. For copying from back volumes of this journal see 'Permissions to Photo-Copy: Publisher's Fee List' of the CCC.

**Beilagenhinweis:** Dieser Ausgabe (Inlandsauflage) liegt ein Prospekt der VCH GmbH, 6940 Weinheim, bei.